

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2011125991/15, 23.06.2011

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:

24.06.2010 US 12/822329

(43) Дата публикации заявки: 27.12.2012 Бюл. № 36

Адрес для переписки:

129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр.3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"

(71) Заявитель(и):

ДЖОНСОН ЭНД ДЖОНСОН
КОНЗЮМЕР КОМПАНИЗ, ИНК. (US)

(72) Автор(ы):

УОЛТЕРС Рассел М. (US),
ГАНН Юэн Т. (US),
ГАНДОЛЬФИ Лиза (US),
ДЖОНСОН Донзел (US),
АНИМ-ДАНСО Эмманюэль (US)(54) ПРОЗРАЧНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ КОМПОЗИЦИИ С НИЗКОЙ РАЗДРАЖАЮЩЕЙ
АКТИВНОСТЬЮ И ОТНОСИТЕЛЬНО НИЗКИМ рН

(57) Формула изобретения

1. Очищающая композиция для кожи, содержащая:

(а) низкомолекулярный несшитый линейный акриловый сополимер; и

(б) по меньшей мере одно неэтоксилированное анионное ПАВ, составляющее более чем приблизительно 2% от очищающей композиции для кожи;

причем полное содержание ПАВ в очищающей композиции для кожи не превышает приблизительно 9 вес.% от очищающей композиции для кожи; рН указанной очищающей композиции для кожи составляет приблизительно 6,2 или ниже; и указанная композиция для кожи имеет от 70 тыс. отсчетов/с или менее в тесте на рассеяние света.

2. Очищающая композиция для кожи по п. 1, где указанное полное содержание ПАВ в очищающей композиции для кожи не превышает приблизительно 7 вес.% от очищающей композиции для кожи.

3. Очищающая композиция для кожи по п. 1, где величина оптического пропускания очищающей композиции для кожи составляет более чем приблизительно 90%.

4. Очищающая композиция для кожи по п. 1, где рН очищающей композиции для кожи находится в диапазоне от приблизительно 4 до приблизительно 6,2.

5. Очищающая композиция для кожи по п. 1, содержащая не более чем приблизительно 5 вес.% этоксилированного ПАВ.

6. Очищающая композиция для кожи по п. 1, дающая 50 тыс. отсчетов/с или менее.

7. Очищающая композиция для кожи по п. 6, дающая 40 тыс. отсчетов/с или менее.

8. Очищающая композиция для кожи по п. 5, содержащая не более чем приблизительно 1 вес.% этоксилированного ПАВ.

9. Очищающая композиция для кожи по п. 1, где указанный низкомолекулярный

RU 2011125991 A

RU 2011125991 A

несшитый линейный акриловый сополимер представляет собой сополимер, содержащий первый мономерный компонент, выбранный из группы, состоящей из одного или более α,β -этиленоненасыщенных мономеров, содержащих по меньшей мере одну карбоксильную группу, и второй гидрофобно модифицированный мономерный компонент, выбранный из группы, состоящей из одного или более α,β -этиленоненасыщенных некислотных мономеров, содержащих C_1 - C_9 -алкильную группу, включая линейные и разветвленные C_1 - C_9 -алкилэфиры (мет)акриловой кислоты, виниловые эфиры линейных и разветвленных C_1 - C_{10} карбоновых кислот, а также их смеси.

10. Очищающая композиция для кожи, содержащая:

- (a) низкомолекулярный нешитый линейный акриловый сополимер; и
- (b) по меньшей мере одно неэтоксилированное анионное ПАВ, составляющее более чем приблизительно 2 вес.% от описываемой очищающей композиции для кожи;
- (c) причем полное содержание ПАВ в указанной очищающей композиции для кожи не превышает приблизительно 9 вес.% композиции для кожи; pH указанной очищающей композиции для кожи составляет приблизительно 6,2 или ниже; величина оптического пропускания указанной композиции для кожи составляет более чем приблизительно 90%.

11. Очищающая композиция для кожи, содержащая:

- (a) низкомолекулярный нешитый линейный акриловый сополимер; и
 - (b) по меньшей мере одно неэтоксилированное анионное ПАВ, составляющее более чем приблизительно 2 вес.% от описываемой очищающей композиции для кожи;
- причем полное содержание ПАВ в указанной очищающей композиции для кожи не превышает приблизительно 7 вес.% от очищающей композиции для кожи; pH указанной очищающей композиции для кожи составляет приблизительно 6,2 или ниже; и указанная очищающая композиция для кожи имеет от 70 тыс. отсчетов/с или менее в тесте на рассеяние света.